03;04;07;12 Широкополосный спектр излучения непрерывной плазменной струи в смеси инертных газов с молекулами SF₆

© В.С. Рогулич, Л.Л. Шимон

Ужгородский национальный университет, 88000 Ужгород, Украина e-mail: ishev@univ.uzhgorod.ua

(Поступило в Редакцию 4 марта 2003 г.)

В непрерывной струе плазмы на смеси Ar/Kr/SF₆ обнаружена широкая полоса излучения в видимой области спектра на расстоянии *l* > 75 nm от сопла плазмотрона. Представлены экспериментальные зависимости максимума интенсивности наблюдаемого свечения от параметров плазменного источника.

Ранее [1–3] при исследовании оптимальных условий образования эксимерных молекул KrF*, XeF* и ArF* в непрерывной плазменной струе на смесях инертных газов с молекулами SF₆ нами были обнаружены широкие полосы излучения в видимой области спектра, природа которых не получила объяснения. Это излучение было зарегистрировано на достаточно больших расстояниях (l > 75 mm) от сопла плазмотрона.

В данном сообщении представлен спектр излучения смеси Ar/Kr/SF₆ и основные экспериментальные зависимости интенсивности излучения максимума наблюдаемой полосы на $\lambda_{max} \approx 630$ nm от параметров плазменного источника.

Эксперименты проведены на плазмодинамической установке, где источником плазменной струи служил плазмотрон постоянного тока с газовихревой стабилизацией дуги и звуковым соплом критического диаметра $\sim 5\,\text{nm}$ из графита при токах дуги 50-150 А и падении напряжения на разрядном промежутке 15-35 V. Плазма инертного газа (He, Ar, Kr, Xe) создавалась в дуговой камере плазмотрона, а галогенидные молекулы SF₆ подмешивались в плазму инертных газов как в предсопловой камере, так и в уже сформированную струю плазмы за сопловым блоком на различных расстояниях от него. Давление инертного газа в дуговой и предсопловой камерах изменялось от нескольких десятков Ра до значения 20 kPa. Регистрация излучения струи за сопловым блоком производилась с помощью фотоумножителя ФЭУ-106 и монохроматора МДР-2. Более подробно техника и методика эксперимента описана в работах [1-4].

Запись спектров излучения струи на смеси Ar/Kr/SF₆ производилась в широком диапазоне длин волн (200–800 nm). Во избежание искажений исследуемых спектров в видимой области за счет вклада излучения второго порядка с ультрафиолетовой области, где эффективно излучают эксимерные молекулы KrF*, ArF* и радикалы OH, участок спектра излучения с длиной волны $\lambda < 350$ nm отсекался с помощью светофильтра.

Типичный спектр свечения смеси Ar/Kr/SF₆ представляет собой широкую полосу излучения с максимумом интенсивности на $\lambda \approx 630$ nm и полушириной ≈ 90 nm

в интервале длин волн 550–800 nm (рис. 1). На фоне сплошного спектра присутствуют некоторые интенсивные спектральные линии KrI. Нами изучались зависимости интенсивности в максимуме излучения полосы от параметров плазменного источника. На рис. 2 приведены также зависимости интенсивности излучения полосы при $\lambda \approx 630$ nm от расходов Kr и SF₆. Видно, что при отсутствии криптона или молекул SF₆ в смеси интенсивности излучения полосы принимает практически нулевое значение. Полученные экспериментальные зависимости показывают, что зарегистрированное нами широкополосное излучения присутствует только при наличии в смеси атомов криптона и молекул Элегаза SF₆ одновременно.

На рис. З показана зависимость максимума интенсивности излучения данной полосы в смеси Ar/Kr/SF₆ от расстояния вдоль оси истечения плазменной струи. Видно, что эффективное излучение полосы происходит при $l \approx 80 \,\mathrm{mm}$ от сопла плазмотрона. С увеличением введенной в плазмотрон мощности интенсивность излучения полосы увеличивалась.

Следует отметить, что в смеси He/Xe/SF_6 также была обнаружена широкая полоса излучения в диапазоне длин волн 370-670 nm, однако для данной смеси не были оптимизированы условия эксперимента и результаты требуют дальнейшей доработки и тщательного анализа.



Рис. 1. Спектр излучения струи плазмы на смеси Ar/Kr/SF₆ при $P \approx 8$ kPa, W = 1.8 kW, l = 81.5 mm.



Рис. 2. Зависимость интенсивности излучения полосы при $\lambda = 630$ nm от парциальных расходов криптона при $G(SF_6) = 0.24$ g/s (*a*) и SF₆ при G(Kr) = 0.07 g/s (*b*).



Рис. 3. Распределение интенсивности в максимуме излучения полосы на $\lambda = 630$ nm вдоль струи при $G(SF_6) = 0.1$ g/s, G(Kr) = 0.24 g/s, P = 8 kPa, W = 1.8 kW.

На основании полученных экспериментальных зависимостей и проведенного выше анализа можно предположить, что в плазменной струе на смеси Ar/Kr/SF₆ на достаточно больших расстояниях от сопла идет эффективное образование более сложного, чем известные двухи трехатомные молекулы, возбужденного комплекса, составленного из атомов или ионов тяжелого инертного газа и молекул SF₆ или ее фрагментов. Не исключено участие в образовании предполагаемого нами комплекса также и атомов плазмообразующего газа аргона. Следует отметить, что в условиях сильного переохлаждения плазмы за соплом, где температура электронов $\sim 0.1 \text{ eV}$ в плазменной струе на смеси инертных газов и сильно электроотрицательных молекул SF₆ могут эффективно протекать процессы прилипания электронов с образованием отрицательных ионов SF₆⁻, SF₅⁻, F⁻ и других фрагментов распада молекулы, которые могут служить центрами образования сложных возбужденных комплексов, например кластерного типа.

Что касается других возможных источников рассматриваемого нами широкополосного излучения в смеси Ar/Kr/SF₆, то здесь следует упомянуть хорошо изученные в лазерной физике эксимерные трехатомные молекулы ArKrF* и Kr₂F*, которые дают широкие спектры излучения. Однако молекула ArKrF* излучает в УФ области спектра, излучение из которой мы исключили с помощью светофильтра, а излучение молекулы Kr₂F* сосредоточено в основном в области с $\lambda_{max} \approx 415$ nm. Поэтому мало вероятно, что данные трехатомные молекулы могут быть основными источниками зарегистрированного нами широкополосного излучения смеси Ar/Kr/SF₆.

Список литературы

- [1] *Рогулич В.С., Стародуб В.П., Шевера В.С. //* Опт. и спектр. 1990. Т. 69. Вып. 4. С. 756–758.
- [2] Рогулич В.С., Шевера В.С. // ЖТФ. 1996. Т. 66. Вып. 4. С. 188–191.
- [3] Рогулич В.С., Шевера В.С. // УФЖ. 1999. Т. 44. № 9. С. 1082.
- [4] Рогулич В.С., Шимон Л.Л. // Прикладная физика. 2002. № 4. С. 60–65.